

<http://physicsweb.org/article/news/7/5/13>

2003/05/22

ترانزیسترهای شفاف

پژوهشگرانی در ژاپن ترانزیستر سریع شفاف جدیدی ساخته‌اند، که ده بار سریع‌تر از ابزارها بی‌قبلی است. هیدئو هسون [1] و همکارانش از مؤسسه فناوری و علم ژاپن در کاواساکی، و مؤسسه فناوری یوتکی، این ترانزیستر را از یک لایه بی‌نازک تک‌بلور یک اکسید نیمرسانا ساخته‌اند. این نتیجه‌گامی به سوی اپتوالکترونیک نسل بعد (از جمله پروژکتورها و نمایشگرهای شفاف) است [2].

اکسیدها بی‌نیمرسانا را به گستردگی به عنوان پوشش‌ها بی‌غیرفعال در کاربردهای مثل صفحه‌ها بی‌نمایشگر و یاخته‌ها بی‌خورشیدی به کار می‌برند. بیشتر این اکسیدها شفاف‌اند، اما رسانای الکتریسیته نیستند و نمی‌شود از آن‌ها به عنوان اجزای فعال استفاده کرد. اگرچه اکسیدها بی‌رسانا می‌شوند، می‌شد از آن‌ها در ساختن مدارهای نامرئی استفاده کرد، که به گستره بی‌واسیعی از کاربردهای اپتوالکترونیکی می‌انجامد.

به طور آرمانی، تحرک یک ترانزیستر اثرباره (فت) [3] باید زیاد باشد، اما تحرک در فت‌ها بی‌ساخته شده با اکسیدهای نیمرسانای شفاف (مثل روی اکسید)، در دمای اتاق بین حدوداً 1 تا 3 سانتی‌متر مربع برولت بر ثانیه است. هسون و همکارانش فت شفافی ساخته‌اند، که تحرک در آن 80 سانتی‌متر مربع برولت بر ثانیه است. علت زیادبودن این تحرک آن است که این فت از یک لایه بی‌نازک تک‌بلور بدون نقیصه ساخته شده.

فعلاً ساختن این ترانزیستر خیلی گران تمام می‌شود، اما این نتیجه نشان می‌دهد ساختن ابزارهای شفاف با تحرک زیاد ممکن است.

X0/030513

γ

- [1] Hideo Hosono
- [2] Science **300** 1269
- [3] field-effect transistor (FET)